

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

特開昭 64-39728 (2)

両膜面だけが直接エッチング浴へのアタックを受けるので、RF両膜式箔通板1の膜面の変異を生じる。

この問題を解決するため、図3図のように、
凡そ泡盛を製造板1の表面を泡盛性被膜2によつて被覆することと考へられる。しかし、このようにしてもカーボンである凡そ泡盛性製造板1と泡盛性被膜2との導電性が低く、その上、容易にエッチングロスと泡盛性被膜2が反転してしまひので、被膜と凡そ泡盛性製造板1との間に厚膜が生成されて泡盛性被膜2が剥離するといふ問題がある。

〔 勇明が解決しようとする問題点 〕

このように上述した弊害の軽減はCVD膜のエッチングを行うとエッチングガスにより不足部は電極形成の阻害、バスの腐蝕、基板の酸化化という問題点があり、たとえ半導体膜のエッチングを行つても膜厚が制御してしまうという問題点があった。

本発明は上記のような問題点を解決するため

して照射し、 R_2F 発振電極基板 1 の表面をラビングする。照射された面は R_2F 発振電極基板 1 上で冷却されて、収縮したまま状態で固着する。7 は絶縁性被膜 8 を被覆する耐エッチングガス膜にすぎた N_2 等の絶縁性被膜、8 は導電性被膜 7 上に形成された非常に多孔率の小さい Al_2O_3 等の絶縁性被膜である。導電性被膜 7、絶縁性被膜 8 は、例えば、次のように形成する。まず、 N_2 、 H_2 、不活性ガス等を電極をさせて流れる高圧、高速のプラズマジェット中に、コーティングしたい導電性あるいは絶縁性の材料の粉末を送り込み、ジェット中で照射し、加速してから R_2F 発振電極基板 1 に衝突させ、被膜を形成する。この照射粒子がプラズマジェット中に滞留する時間は 0.3 ~ 0.6 秒位で、この時間内に粒子は照射し、100 ~ 300 m/秒の速度に加速して衝突する。衝突すると偏平に変形して急速に面化し、衝突した粒子が次々に復原して被膜が形成される。

また、半導体装置工を中間層として用いているのは、超微細装置工だけでは完全にエツケンが

したがため、日清戦争後の復興事業としての
 建設費増大、通貨膨脹化であるインフレーション現象
 財政赤字膨大化等とともに出た。

(問題点を解決するための手段)

本異同は、R₁異同塩基誘致にこれを被覆する
脂質層の他属性阻障と、脂質層誘致を被覆す
る気孔開口の小さい被膜とを改けたものである。

【押席】

[illegible]

【吳祖例】

本発明の一実施例について図を参照し説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す断面使用図であり、1は及び2は接合部材、3は及び4は接合部材を挟1上に配置された主部材にすくれた凹部、5は接合部材であり、この形成方法は例えば、ホリマックの成形機を2000°〜4000°Cの温度で一アムチレン系で被覆し、その被覆をエバニエント炉で乾燥

又の侵入を防ぐのは困難であるためである。

以上、本発明例では、 β -D-グルコース糖鎖1を基材
 として説明したが、アラビノマンナン糖鎖は、
 遊離状態でエプタングラスにある β -D-アラビノ
 マン糖を受けようとする部位では全く適用でき、其の
 結合化を図ることが出来る。

このように、本実施例では遮断性被膜をより
見易く電極板を被覆することの創案を明くことである。
導電性被膜および遮断性被膜の使用によつてエ
ンタングダムの侵入を防ぐことができる。

【说明与效果】

以上のより、本病の発生は、凡そ寒湿を原因とし、
熱を起す能はば、鼻孔性の少ない状態により誘
はれてゐるので、エツアングスの侵入を防ぎ、西
疫からのローラインダ等の隔離を怠らざること
で、凡そ病源を徹底的に排除し、ダストの発生を
防ぎ、患部の長寿命化を図ることが出来る。

4. 圖面之標準及說明

第2図(a), (b)は各案例の断面図および正面図、第

